

BEST AVAILABLE COPY

⑩

国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公

特許公報(A)

平2-224242

⑬Int. Cl.

識別記号

⑭整理番号

⑮公開 平成2年(1990)9月6日

H 01 L 21/302

N

8223-5F

21/31

A

8223-5F

C

5810-5F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

⑯発明の名称 半導体基板処理装置

⑰特 願

260502

⑱出 願

1989)10月5日

優先権主張 ⑲昭63(1988)11月21日

(JP)⑳特願 昭63-294114

㉑発 明 者 宮 川 康 夫

【京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

㉒出 願 人 沖電気工業株式会社

【京都港区虎ノ門1丁目7番12号

㉓代 理 人 弁理士 柿本 恭 夫

明 細 書

1. 発明の名称

半導体基板処理装置

2. 特許請求の範囲

1. 半導体基板を収容するチャンバーのチャンバー内で前記半導体基板上のエッチング処理もしくは前記チャンバ半導体基板に対する膜の堆積処理を施板処理装置において、

前記チャンバー内に形成されるポリ膜の状態を光学的に検出する検出部前記検出部の出力に基づき前記ポリ膜の状態が許容範囲内にあるか否かう評価部とを、

設けたことを特徴とする半導体基板

2. 請求項1記載の半導体基板処理装置

前記検出部は、前記チャンバー内にする発光装置と、前記チャンバー内で偏光の反射光を受光する受光装置と前記評価部は、前記受光装置の出力

記ポリマー或は堆積膜の特性値を算出し、その算出値が許容値内にあるか否かの判定を行う機能をも有する半導体基板処理装置。

3. 請求項1記載の半導体基板処理装置において、前記検出部は、前記チャンバー内を照らす光源と、前記チャンバー内における所定箇所の表面像を受光する受光装置とで構成し、

前記評価部は、前記受光装置の出力に基づき、前記受光した表面像と予め設定された像との比較、判定を行う画像処理機能を有する半導体基板処理装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体基板処理装置、特にそのチャンバーのクリーニング時間決定に供する手段に関するものである。

(従来の技術)

従来、このような分野の技術としては、「ソリッド ステート テクノロジー」(Solid State Technology) (1988-4) ペンクエル バブリ

ッシング カンパニー(Pennwell Publishing Company) P. 109-112に記載されるも
った。前記文献には半導体基板に対する処
ち、ドライエッチング プロセスに関する
記載されている。以下、その構成を説明す

二酸化ケイ素(SiO_2)膜に対するエ
グにおいて、高エッチングレートの実現及
の多結晶シリコン或は単結晶シリコンとの
比を実現するために、六フッ化イオウ(S
と三フッ化メタン(CHF_3)の混合ガス
2ステップのエッチングプロセスが有効で

この2ステップのエッチングプロセスは
混合ガス組成を変えて2段階のプラズマエ
グを施すもので、第1のステップでは高エ
グレートを実現するために SF_6 のガス組
成を高く設定する。また、第2のステップでは
の選択比を高めるために、 CHF_3 のガス
を高く設定する。第1のステップで予定の
の SiO_2 膜をエッチングし、残りを第2
ステップでエッチングすることにより、高エッ

定性に重大な影響を及ぼす。ここに、前記
スでチャンパーにクリーニングを施さない
において、エッチングレートは半導体基板約
枚終了時まで殆ど一定であり、パーティク
増加は約1000枚処理時でも0.08個
²程度という結果が得られている。これら
から、半導体基板500枚程度まではチャ
にクリーニングを施すことなく安定した速
が可能であると考えられている。

以上の $\text{SF}_6 + \text{CHF}_3$ ガスを用いたフ
エッチングの他に、六フッ化エタン(C_2
+ CHF_3)のフロロカーボン系のガスを
ラズマエッチングも広く行なわれている。
のエッチングにおいても、同様の半導体基
装置が用いられており、そのチャンパー内
されるポリマーに起因してエッチングプロ
安定性が変動する。そして、半導体基板の
枚を目安としたチャンパークリーニング時
定が広く行なわれている。

(発明が解決しようとする課題)

レート及び高選択比のエッチングが達成される。

前記エッチングプロセスは、被エッチング用半
導体基板を収容してプラズマ放電を施すチャン
パーを備えた半導体基板処理装置によって行なわれ
る。前記チャンパー内への半導体基板の供給と2
ステップエッチングとを繰り返すことにより、多
数枚の半導体基板に対する連続処理がなされる。
その際、第2のステップでは CHF_3 のガス組成
比を高く設定しているため、チャンパー内には C
 HF_3 に起因するフロロカーボン系のポリマーが
形成される。ところがこのポリマーは、次に繰り
返される SF_6 組成比の高い第1のステップで削
減され、ポリマー膜厚の増加によるエッチング特
性の変動が抑制される。また、ポリマーに起因し
て発生するパーティクル(微粒子)の低減も図ら
れる。

前記エッチングプロセスの安定性は、半導体基
板連続処理時におけるエッチングレートの変動と
パーティクル数の増加によって評価されるもので
あり、チャンパー内に形成されたポリマー量が安

しかしながら、上記の半導体基板処理装置を用
いた基板処理では、チャンパーのクリーニング時
期を容易かつ適切に決定できないという課題があ
った。

即ち、クリーニング時期を決定するためには、
それぞれのエッチング条件下において多数回のエ
ッチングを繰り返し、エッチングレートやパーティ
クル数に関する実績データを集積した後、それ
らの解析値等から基板処理枚数に基づくクリーニ
ング時期を決定せねばならず、実用上極めて困難
な上に精度上の問題もある。また、クリーニング
時期決定のために、例えば半導体基板の処理枚数
等の管理値を設定しても、管理値に対するエッチ
ング特性のばらつきに対応しきれないという問題
が残る。さらに、処理装置におけるトラブル等の
不測の事態には全く対応することができない。こ
れらの管理値からのばらつきや不測の事態を生じ
れば、半導体基板の著しい歩留り低下を来してし
まう。

本発明は、前記従来技術がもっていた課題とし

て、チャンパーの適切なクリーニング時が困難な点、及び半導体基板の歩留り低す点について解決した半導体基板処理装置するものである。

(課題を解決するための手段)

前記課題を解決するために、第1の発明は、半導体基板を収容するチャンパーを有し、チャンパー内で前記半導体基板上の膜に対するクリーニング処理もしくは前記チャンパー内で前記基板に対する膜の堆積処理を施す半導体装置において、前記チャンパー内に形成ポリマー或は堆積膜の状態を光学的に検出部と、前記検出部の出力に基づき前記ポリマー或は堆積膜の状態が許容範囲内にあるかを評価部とを、設けたものである。

第2の発明では、第1の発明において、検出部は、前記チャンパー内に偏光を照射装置と、前記チャンパー内で反射した偏反射光を受光する受光装置とで構成する。前記評価部は、前記受光装置の出力に

第2の発明において、発光装置がチャンパー内に偏光を照射すると、その反射光が受光される。すると、評価部では、受光装置を入力し、所定の演算を行ってその演算結果との比較、判定を行う。

第3の発明において、光源がチャンパーからすると、そのチャンパー内の表面像が受光される。評価部では、受光装置の出し、受光した表面像と予め設定された値判定を行う。

従って、前記課題を解決することがて(実施例)

第1図は、本発明の第1の実施例を示す半導体基板処理装置の概略構成図である。

この半導体基板処理装置は、プラズマグに用いられるもので、チャンパー1を有し、チャンパー1の内部上面及び下面に上部電極2及び下部電極3が設けられ、上部電極2は高周波電源(RF電源)4に接続されている。

記ポリマー或は堆積膜の特性値を算出し、その算出値が許容値内にあるか否かの判定を行う機能を有している。

第3の発明では、第1の発明において、前記検出部は、前記チャンパー内を照らす光源と、前記チャンパー内における所定箇所の表面像を受光する受光装置とで構成する。前記評価部は、前記受光装置の出力に基づき、前記受光した表面像と予め設定された像との一致/不一致を判定する画像処理機能を有している。

(作用)

第1の発明によれば、以上のように半導体基板処理装置を構成したので、検出部は、チャンパー内に形成されたポリマー或は堆積膜の状態(例えば、膜厚やその物質特性)を光学的に検出してその状態を直接的及び定量的に観察する働きをする。評価部は、検出部の出力に基づき、前記状態が許容範囲内にあるか否かの判定、評価を行い、チャンパーのクリーニング時期を決定し、それを管理する働きがある。

前記チャンパー1の互いに向向する側壁には、それぞれ光透過用の窓5、6が設けられている。一方の窓5側には、例えばレーザと偏光板とから成る発光装置7が設けられ、他方の窓6側には、受光素子等で構成された光/電変換用の受光装置8が設けられている。

発光装置7及び受光装置8により、検出部が構成されている。この発光装置7及び受光装置8の相対的な位置関係は、レーザ光源から偏光板を経た偏光が上部電極2において反射し、その反射光が受光装置8に入射するように設定されている。

受光装置8の出力側には、評価部9が接続されている。評価部9は、演算回路及びメモリ等を有するコントローラで構成されている。

次に、上記構成の半導体基板処理装置を用いた SiO_2 膜のプラズマエッチングについて説明する。

半導体基板10上に形成された SiO_2 膜のプラズマエッチングにおいて、 $C_2F_6 + CHF_3$ 等のフッ素系炭素系の混合ガスがエッチングガ

スとして用いられることが多い。このエッチングに有効であるが、チャンバー1のロコカーボン系のポリマーを形成するポリマーはプラズマ状態と密接に関連し、定常状態にある場合には所定のエッチ即ち所定の均一性、選択比及び形状を与えることができる。

前記 $C_2F_6 + CHF_3$ の混合ガスエッチングを施すに際し、先ず半導体基板1内の下部電極3上に設置すRF電源4によりRFパワーを上部電極2に供給し、半導体基板10の SiO_2 膜にエッチングを施す。同様の動作を繰り返す多数枚の半導体基板11に対するエッチングされる。

このエッチングプロセスにおいて、 CHF_3 ガスを用いることによりチャンバー1内の上部電極2を含む内壁面にはポリマーが形成される。このポリマーの形成状態を観察す光装置7から偏光を生ぜしめ、窓5を

評価することによって行なうことができる。上記の発光装置7及び受光装置8に一の観察は、例えば個々の半導体基板10のエッチング終了後、プラズマ放電が基板搬送時に繰り返して実施されるプラズマ放電の影響を受けずに再現性を観察することができる。

このように本実施例では、ポリマーを定量的に観察することにより、チャンバー1のクリーニング時間を決定するので、的確に下すことができる。また、エッチング時に把握できるので、そのばらつきを小さく抑えられると共に、装置トラブルにも的確に対応できる。さらに、半導体基板10の搬送時に観察するので、エッチングに悪影響を与えず、工程を進捗させることができる。

第2図(a)、(b)は、本発明の例を示す半導体基板処理装置の概略構成。第1図中の要素と共通の要素には共通

エッチングにポリマーが形成され、その反射光が窓6を経て受光装置8に入射する。受光装置8は入射した偏光の情報を評価部9に伝え、評価部9はその情報からポリマーの膜厚及び屈折率の値を算出する。これにより、ポリマーの膜厚や物質特性等を知ることができる。

なエッチングを施す。即ちエッチングが施され、

10のポリマーが形成され、

10のポリマーが形成され、

10のポリマーが形成され、

10のポリマーが形成され、

電極2に向けて出射する。出射された偏光は上部電極2に形成されたポリマー面で反射し、その反射光が窓6を経て受光装置8に入射する。受光装置8は入射した偏光の情報を評価部9に伝え、評価部9はその情報からポリマーの膜厚及び屈折率の値を算出する。これにより、ポリマーの膜厚や物質特性等を知ることができる。

前記評価部9には、所定のエッチング特性を維持できるポリマー膜厚及び屈折率の許容値が予め記憶されており、エッチング毎に算出された膜厚及び屈折率がこの許容値内にあるか否かをチェックする。算出値が許容値を超えたときにはアラームを発してチャンバー1のクリーニング時間を知らせたり、もしくはクリーニングの実施及びクリーニング後の偏らし放電を実施するようにプログラムされている。

前記ポリマー膜厚及び屈折率の許容値の設定は、電極温度の変動及び塗料や酸素の混入等、半導体基板10の連続処理中に想定される現象がエッチング特性及びポリマー状態に与える影響を事前に

されている。なお、第2図(a)は上部電極2を観察する図、第2図(b)は下部電極3を観察する図である。

この半導体基板処理装置は、第1の実施例と同様に、プラズマエッチングに用いられるもので、チャンバー1、上部電極2、下部電極3、RF電源4、及び窓5、6を備えている。

一方の窓5側には、チャンバー1内を照らすための光源7Aが設けられ、他方の窓6側には、受光装置8Aが設けられている。受光装置8Aは、光源7Aによって照らされた上部電極2や下部電極3等の表面像を受光するもので、その表面像を結像するための光学系11と、光/電変換機能を有するCCD(荷電結合素子)型固体撮像素子等の光センサ12とを備えている。

光センサ12の出力側には、画像処理装置やCRT等で構成される評価部9Aが接続されている。

この半導体基板処理装置では、第1の実施例と同様に、半導体基板10に対するプラズマエ

ッチングが行われる。

チャンパー1内に形成されたポリマー膜を観察する場合、RF電源4を印加し例えば半導体基板1の搬送時に行なう。

即ち、第2図(a)に示すように、光より、窓5を通して上部電極2を照らす上部電極2の表面像が、窓6及び光字列して光センサ12に結像される。光セン入射光を電気信号に変換して評価部9A。評価部9Aでは、光センサ12の出力に像処理を行い、観察された上部電極2のCRT等に表示する。

この評価部9Aには、クリーニングカ合の上部電極2の複数の表面像が予め蓄いる。評価部9Aは、観察された表面像記憶された表面像とを比較し、観察された記憶された表面像の一つと一致したアラームを発してチャンパー1のクリー期を知らせたり、あるいはクリーニング後クリーニング後の値らし放電を実施す

この第2の実施例では、より広範な領域一観察が可能となる。

なお、本発明は図示の実施例に限定さ々の変形が可能である。その変形例として以下のようなものがある。

(1) 第1図では、発光装置7からの部電極2に照射し、上部電極2上のポリ察するものとしたが、第2図で説明した半導体基板1が設置される下部電極3以ンパー1内壁においてポリマーを観察すしてもよい。このようにしても、チャンクリーニング時期を決定することができ

(2) 第1図の発光装置7はレーザーとら成るものとしたが、これに限らず偏光るならば、如何なる構成としてもよい。光装置7及び受光装置8は、エリブソメよって構成することもできる。

(3) 被エッチング膜は SiO_2 膜のされるものではなく、エッチングガスも $+CHF_3$ のみに限定されない。例えば

銅する。

従って、第1の実施例とほぼ同様に、ポリマーの膜厚及び屈折率等を直接的及び定量的に観察してチャンパークリーニング時期の的確な管理が行える。しかも、第1の実施例では、発光装置7が例えばレーザー及び偏光板で構成されているので、装置が大型化するおそれがあるが、この第2図(a)の実施例では、単なる照明用の光源7Aを用いればよいので、装置の小型化が図れる。

第2図(a)では、上部電極2の表面を観察することにより、チャンパークリーニング時期を決定しているが、第2図(b)に示すように、光字系11及び光センサ12の光軸を変える等して、下部電極3の表面を観察することにより、チャンパークリーニング時期を決定することも可能である。同様にして、上部電極2及び下部電極3以外の箇所の観察も可能である。

従って、第1の実施例では、ポリマー観察を一箇所でのみ行うので、チャンパークリーニング時期を必ずしも的確に決定できるとはかぎらないが、

$+CHF_3$ や SF_6 +五フッ化塩化エタン(C_2ClF_5)等の比較的ポリマーが形成されにくいガスを用いたエッチングに対しても、上記実施例を適用できる。

(4) 上記実施例では、半導体基板処理装置としてエッチング装置について説明したが、本発明は化学的気相堆積法(CVD法)等における堆積装置としての半導体基板処理装置にも適用可能である。即ち、堆積装置の場合にはチャンパー内に堆積膜が形成されるが、この堆積膜に対しエッチングのポリマーと同様の扱いを施すことにより、第1図または第2図とほぼ同様の装置を利用することができる。

(発明の効果)

以上詳細に説明したように、第1、第2の発明によれば、ポリマー或は堆積膜の状態を光学的に検出する検出部と、前記状態を評価する評価部とを設けたので、チャンパー内に形成されたポリマー或は堆積膜の膜厚やその物質特性等を直接的及び定量的に観察することができる。これにより、

チャンバのクリーニング時期に的確かつ容易に下せるようになり、しグ成は堆積特性のばらつきを極力抑減トラブル等の不測事態にも的確にができる。また、スルーアットに悪工程を効率的に差渉させることも可って、半導体基板の処理工程における化と歩留り向上が達成できる。

第2の発明では、発光装置の偏光チャンバ内を照射しているのに対し、第単に光源を用いてチャンバ内を照そのため、第3の発明では、小型で、装置構成となり、より広範な領域の堆積膜の情報を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例を示す基板処理装置の構成図、第2図(a)、発明の第2の実施例を示す半導体基板構成図である。

1……チャンバ、2……上部電極、

「が的
「チン
「つ装
「こと
「えず
「。従
「効率

「ヤン
「]では、
「いる。
「単な
「成は

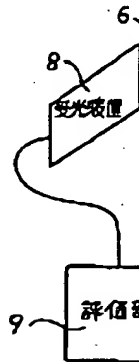
「体基
「は本
「置の

「下部

電極、7……発光装置、7A……光源、8、8A……受光装置、9、9A……評価部、10……半導体基板。

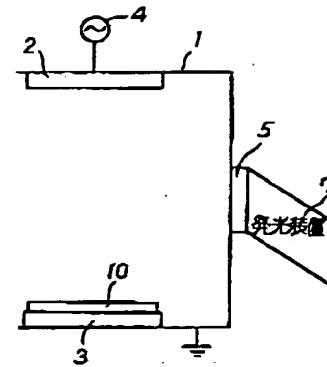
出願人 沖電気工業株式会社
代理人弁理士 柿本恭成

1
2
3
10



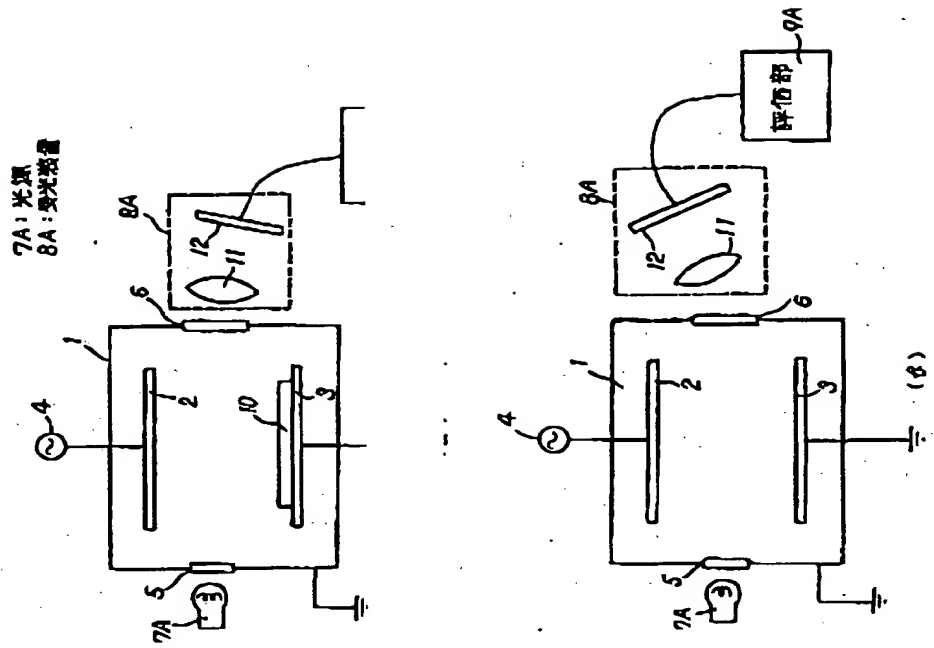
例

「セ
「極
「掃
「基板



例の半導体基板処理装置

図 1 図



第2の実施例の半導体基板上処理装置

第2図

特開平2-224242(8)

チャンバーのクリーニング時間に対する時間が何
程かつ容易に下せるようになり、しかもエッチン
グ液は液面特性のばらつきを強力抑制し、かつ装
置トラブル等の不都合にも的確に対応すること
ができる。また、スループットに悪影響を与えず、
工程を効率的に進行させることも可能となる。従
って、半導体装置の処理工程における著しい効率
化と歩留り向上が達成できる。

第2の発明では、発光装置の偏光によりチャ
ンバー内を照射しているのに対し、第3の発明では、
偏光を光線を用いてチャンバー内を照らしている。
そのため、第3の発明では、小型で、より簡単な
装置構成となり、より広範囲領域のポリマー膜は
加熱膜の加熱を得ることができ。

4. 図面の簡単な説明

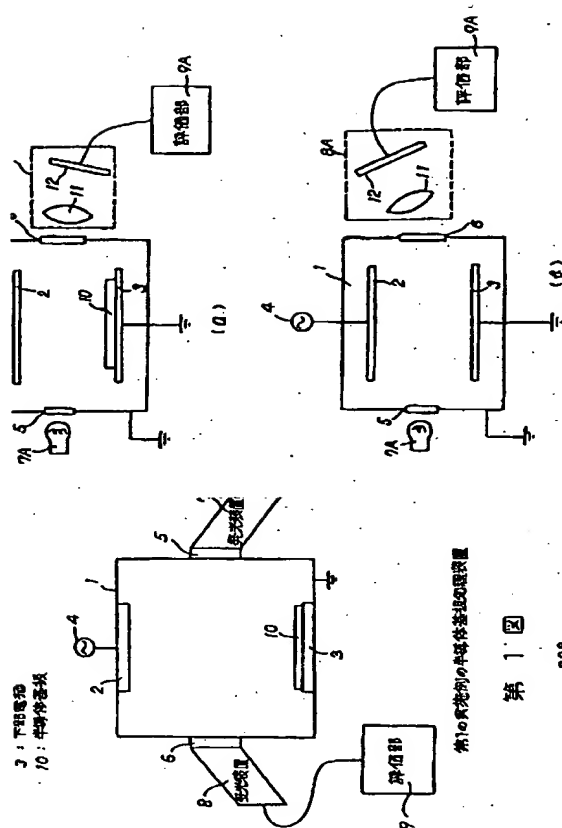
第1図は本発明の第1の実施例を示す半導体基
板処理装置の構成図、第2図(a)、(b)は本
発明の第2の実施例を示す半導体基板処理装置の
構成図である。

1……チャンバ、2……上部電極、3……下部

電極、7……発光装置、7A……光源、8、8A
……受光装置、9、9A……評価部、10……中
媒体装置。

出願人 株式会社 神電工業株式会社
代理人 伊藤 裕 幸 成

7A: 光源



第1図

第1の実施例の半導体基板処理装置

第2の実施例の半導体基板処理装置

第2図

Japanese Laid-open U2-26229

Translation of Title of utility model

"A plasma processing apparatus"

Translation of P2 L1 ~ L10

In this kind of plasma processing apparatus, (in prior art) during the plasma etching processing, a polymer generated by a plasma polymerization or a deposited layer of reacted products is adhered on an inner surface of processing chamber and electrode etc. These raise a deterioration of etching characteristics such as an equality of the etching or the etching rate and an increase of a generation of particles, which get a yield of IC worse. So, a plasma cleaning process using Oxygen, for example, has to be operated for removing the deposited layers in order to keep inner side of the processing chamber always clean.

Translation of P3 L1 ~ L8

Besides, in a case the cleaning process operated with respect to each pre-determined number of wafer processed, since amounts of deposited layers adhered inside the processing chamber are varied by wafers' conditions, e.g. existences of resist layers or time of plasma processing, a problem is that the cleaning process is not operated at a preferred period. That is, the cleaning process is apt to operated too early to lose working time or too delayed to deteriorate a yield of IC.

Translation of P5 L15 ~ P6 L6

A transmitting window 8, which is a portion for transmitting through radiated light of plasma, is disposed on a pre-determined portion of the processing chamber and a light detecting device 9 which detects the intensity of plasma light transmitting through the window 8 and a signal processing device 10 is disposed on outer portion of this window 8, in order, facing said window 8. And said signal processing device 10 are connected to, in order, a decision circuit 11 for deciding a start - end time of cleaning process inside the processing chamber 1 using the signal from the signal processing device 10, and a cleaning control unit 12 which a decision signal from the decision circuit 11 is inputted into and controls the cleaning process inside the processing chamber 1.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.